

光刻胶厂家 赛米莱德 光刻胶

产品名称	光刻胶厂家 赛米莱德 光刻胶
公司名称	北京赛米莱德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208
联系电话	15201255285 15201255285

产品详情

北京赛米莱德贸易有限公司供应美国Futurrex新型lift-off光刻胶NR9-3000PY，此款负胶的设计适用于比较宽的波长范围和i线（366纳米）曝光工具。当显影后NR9-3000PY显示出负的侧壁角度，光刻胶厂家，是lift-off工艺中比较简易的光刻胶。和其他胶相比NR9i-3000PY有下面的优势：1. 比较高的光刻速度，可以定制光刻速度来曝光产量 2. 比较高的分辨率和快的显影时间 3. 根据曝光能量可以比较容易的调整侧壁角度 4. 耐温可以达到100摄氏度 5. 用RR5去胶液可以很容易的去胶 NR9-3000PY的制作和工艺是根据职业和环境的安全而设计。在NR9-3000PY里主要的溶剂是，NR9-3000PY的显影在水溶液里完成。属固含量（%）：31-35 主要溶剂：外观：浅液体涂敷能：均匀的无条纹涂敷 100摄氏度热板烘烤300秒后膜厚涂敷自旋速度 40秒自旋。

芯片光刻的流程详解（一）

在集成电路的制造过程中，有一个重要的环节——光刻，光刻胶，正因为有了它，我们才能在微小的芯片上实现功能。现代刻划技术可以追溯到190年以前，1822年法国人Nicephore niepce在各种材料光照实验以后，开始试图复一种刻蚀在油纸上的印痕（图案），他将油纸放在一块玻璃片上，玻片上涂有溶解在植物油中的沥青。经过2、3小时的日晒，透光部分的沥青明显变硬，而不透光部分沥青依然软并可被松香和植物油的混合液洗掉。通过用强酸刻蚀玻璃板，Niepce在1827年制作了一个d' Amboise主教的雕板相的产品。

Niepce的发明100多年后，即第二次世界大战期间才应用于制作印刷电路板，即在塑料板上制作铜线路。到1961年光刻法被用于在Si上制作大量的微小晶体管，当时分辨率5um，如今除可见光光刻之外，更出现了X-ray和荷电粒子刻划等更高分辨率方法。

光刻胶的重要性

在北京化工大学理学院院长聂俊眼里，我国虽然已成为世界半导体生产大国，正负胶，但面板产业整体产业链仍较为落后。目前，上游电子化学品（LCD用光刻胶）几乎全部依赖进口，必须加快面板产业关

键核心材料基础研究与产业化进程，才能支撑我国微电子产业未来发展及国际“地位”的确立。

“假如我们把光刻机比作一把菜刀，光刻胶公司，那么光刻胶就好比是要切割的菜，没有高质量的菜，即使有了锋利的菜刀，也无法做出一道佳肴。”日前，江苏博砚电子科技有限公司技术部章宇轩在接受科技日报记者采访时说。

光刻胶厂家-赛米莱德(在线咨询)-光刻胶由北京赛米莱德贸易有限公司提供。“光刻胶”就选北京赛米莱德贸易有限公司（www.semild.com），公司位于：北京市北京经济技术开发区博兴九路2号院5号楼2层208，多年来，赛米莱德坚持为客户提供好的服务，联系人：况经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。赛米莱德期待成为您的长期合作伙伴！